

分析結果報告書

2006年 7月10日

分析No. 06663

貴社名 株式会社

工場名 前橋精機プラント 液量 約 5000 L (株)アメロイド日本サービス社

機械名 高周波焼入れ設備 流量 10 L/min 分析センター

試料名 高周波焼入れ液 フィルタ名 WF2K(デモ機)

銘柄 設置日 2006年6月8日



試験項目	採取月日	① 6 / 8 (:)	② 6 / 8 (:)	③ 6 / 8 (:)	試験方法
	採取個所	WF2K入口	WF2K出口	ドレーン	
備考					
汚染度	mg/100ml	43	10	3400	JIS B 9931
粒径分布 (μm) 個/100ml	5~15	867,949 (12)	43,725 (8)		JIS B 9930
	15~25	150,853 (12)	3,975 (7)		
	25~50	33,490 (外)	656 (7)		
	50~100	19,458 (外)	29 (5)		
	100<	9,838 (外)	0 (0)		
油分	mg/l	509.2	246.8	531995.0	JIS K 0102
pH					JIS Z 8802
動粘度	40°C mm ² /s				JIS K 2283
全酸価	mgKOH/g				JIS K 2501

▼粒径分布 HIAC/ROYCO自動粒子計測器システムNo.8011 [粒径分布の()内数字はNAS等級。]

微粒子画像処理システム計測法

▼ろ過フィルタ

0.8 μm

5 μm

▼ろ過量

10ml

0.1ml

▼写真倍率

: ×50

所見: ③の汚染度は、ろ過量10mlでは抜けず、1mlではろ紙が溶解してしまったため、0.1mlにて測定しております。

この所見は、一定の方法で採取された試料と正しい試料情報を前提とした参考所見であり、御社の活動を制約するものではありません。

